

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2008年12月24日 (24.12.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/155928 A1

- (51) 国際特許分類:
C08F 220/20 (2006.01) C08F 220/22 (2006.01)
B29C 59/02 (2006.01) H01L 21/027 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/052373
- (22) 国際出願日: 2008年2月13日 (13.02.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2007-162466 2007年6月20日 (20.06.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭硝子株式会社 (ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED)
[JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川口 泰秀

(KAWAGUCHI, Yasuhide) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目1番1号 旭硝子株式会社内 Tokyo (JP). 角崎 健太郎 (TSUNOZAKI, Kentaro) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目1番1号 旭硝子株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 泉名 謙治, 外 (SENMYO, Kenji et al.); 〒1010035 東京都千代田区神田紺屋町17番地 S I A 神田スクエア4階 Tokyo (JP).

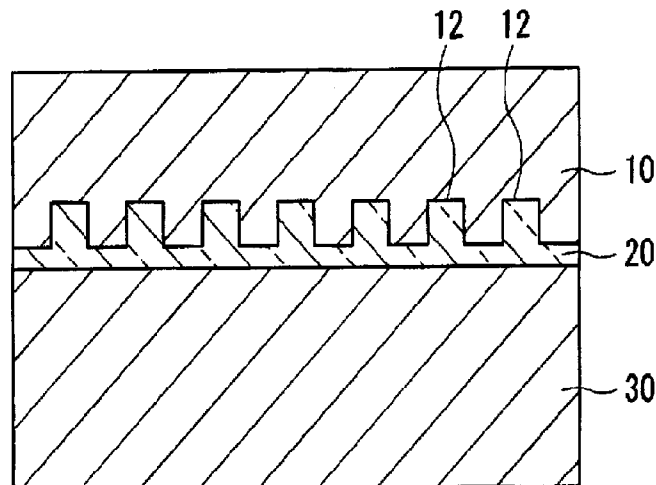
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54) Title: PHOTOCURABLE COMPOSITION AND PROCESS FOR PRODUCING MOLDED OBJECT HAVING FINE PATTERN IN SURFACE

(54) 発明の名称: 光硬化性組成物および表面に微細パターンを有する成形体の製造方法

[図1]



(57) Abstract: A photocurable composition which can give a cured object excellent in releasability and mechanical strength; and a process for producing a molding with excellent durability which has, in a surface thereof, a fine pattern which is a precisely transferred pattern reverse to the pattern of a mold. The photocurable composition (20) comprises: 15-60 mass% compound (A) which is either an aromatic compound having two or more rings or an alicyclic compound having two or more rings and has two (meth)acryloyloxy groups; 5-40 mass% compound (B) having a fluorine atom and one or more carbon-carbon unsaturated double bonds (provided that the compound (A) is excluded); 10-55 mass% compound (C) having one (meth)acryloyloxy group (provided that the compound (B) is excluded); and 1-12 mass% photopolymerization initiator (D) (provided that (A)+(B)+(C)+(D)=100 mass%).

(57) 要約: 離型性および機械的強度に優れる硬化物を得ることができる光硬化性組成物、およびモールドの反転パターンが精密に転写された微細パターンを表面

[続葉有]



WO 2008/155928 A1



SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

添付公開書類:
— 国際調査報告書

に有する、耐久性に優れた成形体を製造できる方法を提供する。環を2つ以上有する芳香族化合物または環を2つ以上有する脂環式化合物であり、かつ(メタ)アクリロイルオキシ基を2つ有する化合物(A)の15~60質量%と、フッ素原子を有し、かつ炭素-炭素不飽和二重結合を1つ以上有する化合物(B)(ただし化合物(A)を除く。)の5~40質量%と、(メタ)アクリロイルオキシ基を1つ有する化合物(C)(ただし化合物(B)を除く。)の10~55質量%と、光重合開始剤(D)の1~12質量%とを含む(ただし(A)+(B)+(C)+(D)=100質量%である。)光硬化性組成物20を用いる。